## DUT GE1 2019-2020 TD SERIE 1 : Semi- Conducteurs

## Compléments du cours

\* En général, la conductivité d'un réni conducteur et donn par l'expression  $T = q(n \mu n + p \mu p)$ où  $19 = 1.6.10^{13}$ c est la charge de l'électron in désigne la concentration des rélectrons (libres) Men désigne la mobilité des électrons (libres) P designe la concentration des trons.

\* Lour un SC pur n=p=ni, alors (= qni (un+µp)

\* Après hypothères et calculs, il resort que la conductivité d'un SC de type N est T = 9ND,Un.

-d'un SC de type ? est [= 9 NA Mp.

\* les mobilités se trouvent dans le tableon donnant les mobilités des trons en des électrons à T=300K.

# EXOA:

Un morceon de rilicium pur a une longueur de 3 mm et une rection transversale rectangularire de 50 pm x 100 pc calculer la resistance et la terrior pentre les restrentes du morceon à T=300°K si l'on mesure un como de 1 pm.

# Exo2

Un morceon de rilicium de type N a les mêmes dime, que le précédent. Calender la conductivité, la résisto et le tention entre les retremités du morceon ni la contration des donnens à 300°K égale 5 x 10<sup>14</sup> cm<sup>-3</sup>

KE TABAU

reçoit dons une unité de production de ce rélactioniques une barres de rilicium de type diamètre de 50 mm et d'une longueur de 20 cm température ambiente (300°K) on merure par (8,5 IL). O Tronver les concentrations des électrons trons à cette température.

@Sachart qu' à 300°K VI=26mV calculer Dn.et Dp castontes de diffusion des trons et des élections. @ si &n = 0,25 ns et &p = 0,25 µs, calculer hn et hj

NB: Conflerent de coms:

Dans in &C de type PN, le potentiel de contract la de NA, NB, de la température. Vo = V7 ln NAND VT = KT, pour les calcul à 300°K, VT = 26 mN. EVE 12 de Pour le vilicium, 0,5 ≤ Vo ≤ 0,7 V. Go = 8:6. L'expension de la largeme do de la jonchion PN est do = \frac{2\xelle \xelle \xelle V \text{ \te

Exo4

résilivités des 2 côtés d'une jouchion PN on milician o, 1 se. con (côté P) et 50s. sem (côté N)

when he potentiel de contact lo, la langem de la shion do et l'interpité du champ rélectique dans la shion Eo à 300° K.

### **EXERCICE 5**

On donne le tableau suivant :

	Eg [eV]	Nc [atomes/cm <sup>3</sup> ]	Nv [atomes/cm <sup>3</sup> ]
AsGa	1,43	4,7.10 <sup>17</sup>	$7.10^{18}$
Ge	0,66	1,04.10 <sup>19</sup>	$6.10^{18}$
Si	1,12	2,8.10 <sup>19</sup>	1,04.10 <sup>19</sup>

- 1. Parmi ces trois semi-conducteurs, quel est celui qui présente la concentration intrinsèque la plus faible ?
- 2. Calculer ni

pour ce semi-conducteur à 300 K.

#### **EXERCICE 6**

Le Germanium est caractérisé par : masse atomique M=72.6~g. masse volumique  $d=5.32 g/cm^3$ 

. énergie de la bande interdite Eg = 0.67 eV.

Nombre d'Avogadro A =  $6,023.10^{23}$  mol-<sup>1</sup>, k =  $8,62.10^{-5}$  eV/K.

Densité effective d'états énergétiques à 300 K,  $Nc = 1,04.10^{19} atomes/cm^3$ ,  $Nv = 6.10^{18} atomes/cm^3$ 

- . 1. déterminer le nombre d'atomes par cm<sup>3</sup>
- . 2. calculer la concentration intrinsèque à 300 K.
- 3. quelle est la fraction d'atomes ionisés ?

## **EXERCICE 7**

Dans le cas du Silicium, à T = 300 K, avec ni = 1,5.10<sup>10</sup> cm<sup>-3</sup>, nombre total d'atomes par cm<sup>3</sup> = 5.10<sup>22</sup>

- . 1. Quel est le rapport du nombre d'atomes ionisés au nombre total d'atomes ?
- 2. Quelle est la largueur de la bande interdite en eV ?

$$Nc = 3.10^{19} \left(\frac{T}{300}\right)^{\frac{3}{2}}$$
 atomes/cm<sup>-3</sup>,  $Nv = 10^{19} \left(\frac{T}{300}\right)^{\frac{3}{2}}$  atomes/cm<sup>-3</sup>

- 3. Déterminer sans calculs le type de semi-conducteur (n ou p) puis les concentrations des porteurs à l'équilibre dans les cas suivants :
- a) Silicium dopé par 10<sup>15</sup> atomes de Ga par cm-<sup>3</sup>
- . b) Silicium dopé par 10<sup>12</sup> atomes de Sb par cm<sup>-3</sup>
- . c) Silicium dopé par 3.10<sup>10</sup> atomes de In par cm<sup>-3</sup>

## **EXERCICE 8**

Dans un semi-conducteur intrinsèque, la concentration de porteurs libres est donnée par la relation suivante :

$$n=p=n_i=A.e^{-\frac{Wc-Wv}{2kT}}$$

- 1. sachant qu'à 300 K la concentration intrinsèque du silicium vaut 6,4.10<sup>9</sup>cm<sup>-3</sup>et que la hauteur de la bande interdite vaut 1,12 eV, déterminer la valeur de A.
- 2. en supposant A indépendant de T, calculer la concentration intrinsèque du silicium à la température d'un four à diffusion (1200 K).

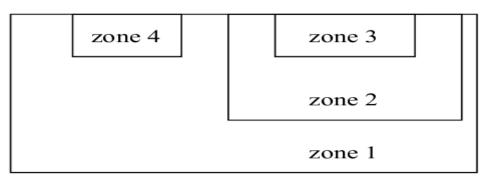
## **EXERCICE 10**

Un matériau intrinsèque est dopé par Nd atomes donneurs et Na atomes accepteurs.

- 1. Donner l'expression de la concentration n0en fonction de niet de N = Nd-Na.
- 2. Quel est le signe de N si le semi-conducteur est de type n ? de type p ?
- 3. On suppose Nd> Na. . Faire un développement limité de n0 en fonction de ni/N
- 4. En déduire la valeur minimale de N /ni pour que l'erreur introduite en utilisant la formule approchée de n0= N soit inférieure à 5 %.

## **EXERCICE 11**

On considère l'élément de semi-conducteur suivant réalisé à partir d'une plaquette de silicium dopée avec une concentration d'atomes accepteurs  $Na=10^{13} cm^{-3}$ . Par des diffusions successives d'impuretés dans la plaquette primitive, on a introduit  $Nd=10^{15} cm^{-3}$  atomes donneurs dans la zone 2 et  $Na=10^{17} cm^{-3}$  atomes accepteurs dans les zones 3 et 4. On se place à la température de 300 K avec  $ni=8,3.10^9 cm^{-3}$ 



- 1. De quel type sont les différentes régions ?
- 2. Ecrire l'équation qui traduit l'équilibre des porteurs et celle qui traduit la neutralité.
- 3. Calculer les concentrations de trous et d'électrons dans chacune des zones.

#### **EXERCICE 12**

La concentration intrinsèque d'un semi-conducteur varie en fonction de la température Suivant :

$$n_i^2 = A_0 T^3 \exp\left(-\frac{Eg}{kT}\right)$$

avec ni=  $2,5.10^{13}$  cm<sup>-3</sup>à 300 K, Eg = 0,67 eV à 300 K pour le germanium et ni=  $1,5.10^{10}$  cm<sup>-3</sup>à 300 K,

Eg = 1.1 eV à 300 K pour le silicium.

Quel est le pourcentage de variation de ni (à 300 K) pour une élévation de température de un degré ?